- 1. Si 肖特基结的势垒高度为 $q\phi_{Bn}$ =0.42 eV,有效理查德常数 $R^*$ =114 A/(cm²·K²), 横截面积为  $10^{-4}$  cm²。计算室温室的理想反向饱和电流和V=0.5 V 时的金半二极管电流。
- 2. 现提供室温情况下测得电极半径为  $100 \, \mu m$  的氧化镓肖特基二极管 I-V 原始数据一份(数据中电流单位 A,电压单位 V),完成下列要求的绘图及参数提取: (1)根据所提供的数据,绘制出肖特基正向电压下的线性坐标 J-V 曲线,并从中提取出:开启电压  $V_{bi}$ : 电流开始出现增长的起点对应的电压即为开启电压; 开态电阻  $R_{ON}$ : 在图中找到正向电流-电压变化的线性区域,其斜率的倒数即为开态电阻  $R_{ON}$ ;
  - (2)根据提供的数据绘出此肖特基二极管正向电压下的半对数坐标 J-V 曲线 (纵坐标 J 为对数坐标,横坐标 V 为线性坐标),并根据热电子发射理论和理查 德森方程从绘出的曲线中提取有关量并计算:理想因子,饱和电流密度,肖特基势垒高度  $q\phi_{Bn}$ 。